

(6)

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

代理人
藤村 元彦

様

あて名
〒104-0045
日本国東京都中央区築地4丁目1番17号銀座大野
ビル 藤村国際特許事務所PCT
国際調査機関の見解書
(法施行規則第40条の2)
〔PCT規則43の2.1〕発送日
(日.月.年)

17.05.2005

出願人又は代理人
の書類記号 PCT01-05006

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号 国際出願日 優先日
PCT/JP2005/005650 (日.月.年) 22.03.2005 (日.月.年) 26.03.2004国際特許分類 (IPC) Int.Cl.⁷ G11B5/84出願人（氏名又は名称）
パイオニア株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

第I欄 見解の基礎
 第II欄 優先権
 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
 第IV欄 発明の單一性の欠如
 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
 第VI欄 ある種の引用文献
 第VII欄 国際出願の不備
 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

19.04.2005

名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
郵便番号 100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

橋 均憲

電話番号 03-3581-1101 内線 3551

5D 3045

第I欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

この見解書は、_____語による翻訳文を基礎として作成した。
それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、
以下に基づき見解書を作成した。

a. タイプ 配列表
 配列表に関連するテーブル

b. フォーマット 書面
 コンピュータ読み取り可能な形式

c. 提出時期 出願時の国際出願に含まれる
 この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された
 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 3-6 請求の範囲 1, 2, 7-10	有 無
進歩性 (I S)	請求の範囲 6 請求の範囲 1-5, 7-10	有 無
産業上の利用可能性 (I A)	請求の範囲 1-10 請求の範囲	有 無

2. 文献及び説明

・請求の範囲 1, 2, 7-10

文献1 : JP 2000-207738 A (松下電器産業株式会社)
2000.07.28, [0076], 図11 (ファミリーなし)

文献1には表面にレジスト層が形成された非磁性基体を回転させながら電子ビームを照射して所望のサーボパターンを露光することが記載され、特に図11及び【0076】段落には「パターン形状に合わせて電子ビームを走査することにより、非磁性基体を一周させる間に数トラック分を一度にパターン露光することが可能」と記載されている。

ここで、文献1の図10の27c領域などはトラックごとに露光されたものが示されているが、当該技術分野において再生クロック等をトラックを横切るように連続的に形成することは周知慣用技術にすぎず、前記構成によってそのような再生クロック等のサーボパターンを露光する場合、「トラックを横切る方向にかつ複数のトラックを跨ぐように電子ビームを照射」しているものと認められ、本願発明と実質的に差違はない。

よって、本願発明の請求の範囲1, 2, 7-10に係る発明に新規性、進歩性はない。

・請求の範囲3-5

文献2 : JP 11-288532 A (ソニー株式会社)
1999.10.19, 図4-6 (ファミリーなし)

文献2にはレジストに対して電子ビームを照射して所望パターンを露光する露光装置が記載され、特に複数の異なる形状のパターンを有するマスクを利用し、半径方向に長い所望のパターンを露光可能であることが示唆されている。

そして、文献1において数トラックを一度にパターン露光する際に、文献2に記載されたようなマスクを利用して露光することは当業者にとって自明なことである。

補充欄

いづれかの欄の大きさが足りない場合

第 V 欄の続き

・請求の範囲 6

文献 3 : JP 7-65363 A (株式会社日立製作所)

1995.03.10, 全文、全図 (ファミリーなし)

文献 4 : JP 9-204654 A (ソニー株式会社)

1997.08.05, 全文、全図 & US 5828536 A

文献 5 : US 2004/57158 A1 (FUJI PHOTO FILM CO., LTD.)

2004.03.25, 全文、全図 & JP 2004-110949 A

文献 6 : JP 8-180350 A (株式会社日立製作所)

1996.07.12, 全文、全図 (ファミリーなし)

文献 7 : JP 2002-324312 A (松下電器産業株式会社)

2002.11.08, 全文、全図 (ファミリーなし)

文献 8 : JP 11-224422 A (日本電信電話株式会社)

1999.08.17, 全文、全図 (ファミリーなし)

文献 9 : JP 2001-67736 A (松下電器産業株式会社)

2001.03.16, 全文、全図 (ファミリーなし)

文献 1 - 9 は当該技術分野における一般的技術水準を示す文献であるが、「電子ビームの照射位置が第 1 所定トラックにあって原盤の回転角度が所定の回転角度にあるとき前記第 1 所定トラックより前記原盤の外側の前記原盤の半径方向に前記第 1 所定複数分のトラックに亘って連続的に電子ビームを照射させ、その後、前記電子ビームの照射位置が前記第 1 所定トラックより前記原盤の外周側に少なくとも前記第 1 所定複数分のトラックだけ離れた第 2 所定トラックにあって前記原盤の回転角度が前記所定の回転角度にあるとき前記第 2 所定トラックより前記原盤の外周側の前記原盤の半径方向に第 2 所定複数分のトラックに亘って連続的に電子ビームを照射させ、前記原盤の前記所定の回転角度において前記第 1 所定複数分のトラック間距離より長手の連続パターンを潜像として形成させる」技術に関しては記載も示唆もされていない。